

第201回講演会

主催: 中国地区化学工学懇話会

日時: 2018年5月31日(木) 14:00-16:00

場所: 広島大学 工学部 113 教室

趣旨:

膜型反応器とは、化学プロセスのキーテクノロジーである反応と分離を一つの装置で行うことで装置コンパクト化が可能というだけでなく、選択的引抜による平衡シフトなどによる反応率・選択性向上などのプロセス強化が可能となる。本講演会では、シリカ気体分離膜の作製、脱水素反応触媒の調製、さらには特性評価の近年の進展を概観するとともに、触媒膜反応への展開について議論する。

講演者:

- ・広島大・都留稔了氏「ゾルゲル法シリカ膜の開発と触媒膜型反応器によるプロセス強化」
- ・芝浦工大・野村幹弘氏「CVD法シリカ膜の開発と触媒膜型反応器によるプロセス強化」
- ・静岡大・福原長寿氏「膜型反応器における構造体触媒の利点－脱水素反応を例に」
- ・産総研・伊藤賢志氏「陽電子消滅法(PALS)によるシリカ系薄膜のナノ構造評価」